

# LAZER LİTOGRAFİ SİSTEMİ



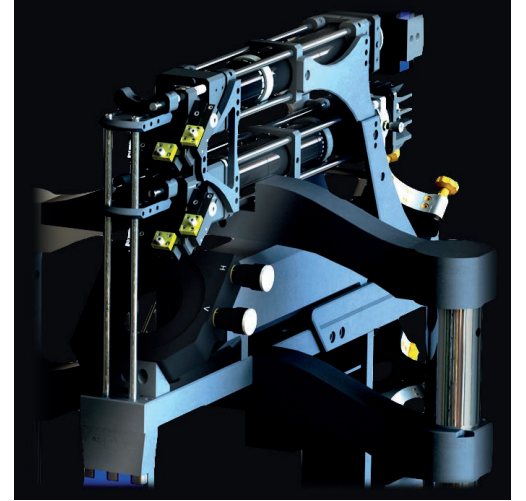
**made in FRANCE**



### MASA ÜSTÜ LAZER LİTOGRAFI SİSTEMİ

- Kompakt cihaz boyutu: 550 x 670 x 700 mm
- Mevcut lazer kaynakları: 375 veya 405nm
- 1 demet boyutu
- Yüksek çözünürlüklü video konumlandırma sistemi
- PC kontrol arayüzü
- PC entegreli yazılım: Kloé Design V.2
- LWI (Kloé Design format), DXF ve GDS2 veri formatlarını desteklemektedir.
- Otomatik odaklama ayarı
- Üç yazı modu: vektörel, tarama ya da her ikisinin olduğu kombinasyon
- Performans

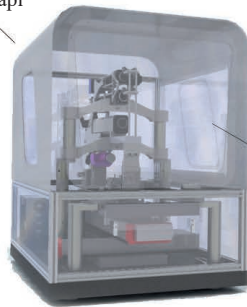
Lineer yazma hızı:	> 100mm/s
Stage hareket çözünürlüğü:	100nm
Tekrarlanabilirlik:	100nm
Wafer yazma alanı:	1 - 4 inc
Yüzey kalınlığı:	150 µm - 5 mm
Lazer nokta boyutu:	1µm - 50 µm
Form faktörü:	minimum 10
Standart hizalama hassasiyeti:	1µm



Güvenli muhafaza

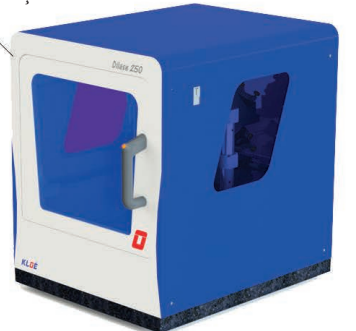


Güvenilir ve sağlam opto mekanik yapı



Stabil ve doğrultulan granit taban

Kolay ve hızlı kapak açma sistemi



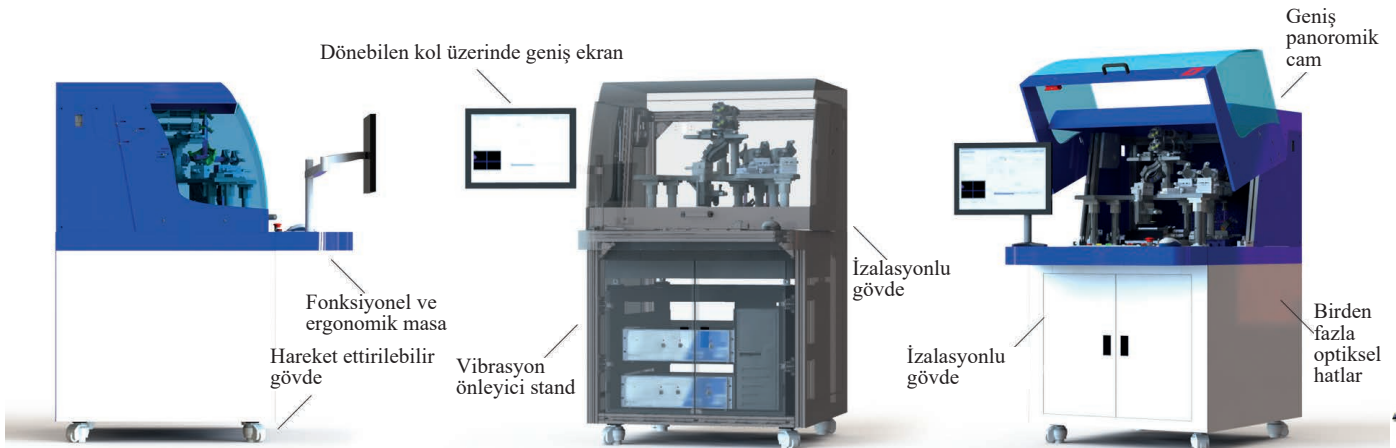
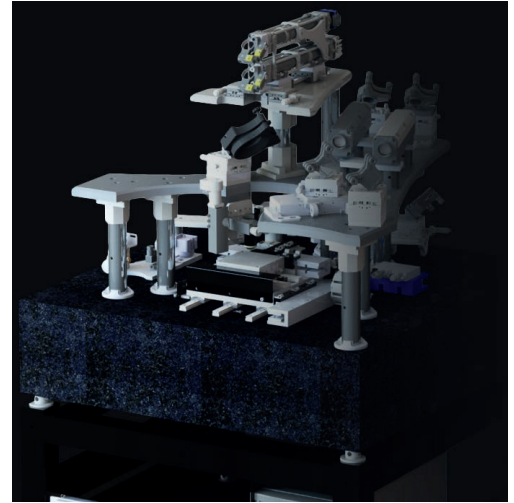
Motorlu değişimleri dinamik olarak kontrol



## YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ FONKSİYONEL LAZER LİTOGRAFI SİSTEMİ

- Cihaz boyutu: 1270 x 970 x 1650 mm
- Mevcut lazer kaynakları: 266, 375 veya 405nm
- 1' den 2'ye kadar optiksel sub-assemblies
- Yüksek çözünürlüklü video konumlandırma sistemi
- PC entegreli yazılım: Kloé Design V.2
- LWI (Kloé Design format), DXF ve GDS2 veri formatlarını desteklemektedir.
- Otomatik odaklama ayarı
- Üç yazı modu: vektörel, tarama ya da her ikisinin olduğu kombinasyon
- Performans

Lineer yazma hızı:	> 500mm/s
Stage hareket çözünürlüğü:	100nm
Tekrarlanabilirlik:	100nm
Wafer yazma alanı:	1 - 6 inc
Yüzey kalınlığı:	250 $\mu$ m - 10 mm
Lazer nokta boyutu:	1 $\mu$ m - 50 $\mu$ m
Form faktörü:	minimum 10
Standart hizalama hassasiyeti:	500nm





## KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ÇOK FOKSİYONEL LAZER LİTOGRAFI SİSTEMİ

- Cihaz boyutu: 1801 x 1204 x 1790 mm
- Mevcut lazer kaynakları: 266, 325, 375, 405 veya 445nm
- 1' den 3'e kadar optiksel sub-assemblies
- Yüksek çözünürlüklü video konumlandırma sistemi
- PC entegreli yazılım: Kloé Design V.2
- LWI (Kloé Design format), DXF ve GDS2 veri formatlarını desteklemektedir.
- Otomatik odaklama ayarı
- Üç yazı modu: vektörel, tarama ya da her ikisinin olduğu kombinasyon
- Performans

Lineer yazma hızı:	> 350mm/s
Stage hareket çözünürlüğü:	40 - 100nm
Tekrarlanabilirlik:	100nm
Wafer yazma alanı:	5 mm'den - 12 inc
Yüzey kalınlığı:	250 µm - 10 mm
Lazer nokta boyutu:	0,5µm - 100 µm
Form faktörü:	minimum 10
Standart hizalama hassasiyeti:	500nm

